【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成20年1月24日(2008.1.24)

【公開番号】特開2002-263173(P2002-263173A)
【公開日】平成14年9月17日(2002.9.17)
【出願番号】特願2001-306791(P2001-306791)
【国際特許分類】
Ａ６１Ｌ　2/14　(2006.01)
Ａ６１Ｌ　2/24　(2006.01)
Ｂ０１Ｊ　19/08　(2006.01)
Ｈ０５Ｈ　1/24　(2006.01)
【ＦＩ】
Ａ６１Ｌ　2/14
Ａ６１Ｌ　2/24
Ｂ０１Ｊ　19/08　Ｅ
Ｈ０５Ｈ　1/24

【誤訳訂正書】
【提出日】平成19年12月5日(2007.12.5)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】特許請求の範囲
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】　物品からガスまたは蒸気化学種を取り除くために消毒システムの真空チャンバの内部の低周波プラズマに与えられる、０ｋＨｚ乃至約２００ｋＨｚの周波数を有する電力を制御可能に調整する低周波電力フィードバック制御システムを備える消毒システムであって、当該低周波電力フィードバック制御システムが、
前記真空チャンバの内部の前記低周波プラズマに与えられる電力を示す第１の信号を生成するのに適した電力モニタと、
前記電力モニタからの前記第１の信号に応じて第２の信号を生成するのに適した電力制御モジュールと、
前記物品が処理されている間に、前記低周波プラズマに与えられるほぼ一定の平均電力を持続するために、前記第２の信号に応じて、前記低周波プラズマに与えられる電力を調整するのに適した電力制御器と
を備える消毒システム。
【請求項２】　物品からガスまたは蒸気化学種を取り除くために消毒システムの真空チャンバの内部の低周波プラズマに与えられる、０ｋＨｚ乃至約２００ｋＨｚの周波数を有する電力を制御可能に調整する方法であって、
前記真空チャンバの内部の前記低周波プラズマに与えられる電力を監視することと、
前記低周波プラズマに与えられる電力を示す第１の信号を生成することと、
前記物品が処理されている間に、前記低周波プラズマに与えられるほぼ一定の平均電力を持続するために、前記第１の信号に応じて、前記低周波プラズマに与えられる電力を調整することとを含む方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６３
【訂正方法】変更

【訂正の内容】
【００６３】
（１１）前記電力制御器は、前記電力制御モジュールからの前記第２の信号に応じて、前記低周波プラズマに与えられる電力のデューティ比を調整するのに適することを特徴とする請求項１に記載の低周波電力フィードバック制御システム。
（１２）前記電力制御器は、前記電力制御モジュールからの前記第２の信号に応じて、前記低周波プラズマに与えられる電力の振幅を調整するのに適することを特徴とする請求項１に記載の低周波電力フィードバック制御システム。
（１３）前記電力は０ｋＨｚ乃至約１０ｋＨｚの周波数を有することを特徴とする請求項１に記載の低周波電力フィードバック制御システム。
（１４）前記電力は０Ｈｚ乃至約４００Ｈｚの周波数を有することを特徴とする請求項１に記載の低周波電力フィードバック制御システム。
（１５）前記低周波プラズマに与えられる前記電力を監視することは、前記低周波プラズマに与えられる電流を監視することと、前記電流を示す第２の信号を生成することと、前記低周波プラズマに与えられる電圧を監視することと、前記電圧を示す第３の信号を生成することとを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６４】
（１６）前記第２の信号および前記第３の信号に応じて、前記第１の信号を生成することを行うことを特徴とする実施態様（１５）に記載の方法。
（１７）前記低周波プラズマに与えられる電力を調整することは、前記低周波プラズマに与えられる電力のデューティ比を調整することを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
（１８）前記低周波プラズマに与えられる電力を調整することは、前記低周波プラズマに与えられる電力の振幅を調整することを含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
（１９）前記電力は０ｋＨｚ乃至約１０ｋＨｚの周波数を有することを特徴とする請求項１に記載の低周波電力フィードバック制御システム。
（２０）前記電力は０Ｈｚ乃至約４００Ｈｚの周波数を有することを特徴とする請求項１に記載の低周波電力フィードバック制御システム。